Si(110)-16×2 清浄表面の最安定構造モデル

(愛媛大学*, KEK-PF**)

○垣内拓大*, 久保田裕之*, 田原雅士*, 間瀬一彦**, 長岡伸一*

【序】 Si(110)- 16×2 清浄表面は、エレクトロマイグレーションを用いることによって単 ードメイン構造を示し、これが他の面に比べ高い電荷移動度効率を示すことから新規デバイ スの基板として注目が集まっている [1]。近年、Si(110)-16×2 清浄表面の最安定構造モデル がいくつか提唱され、最も有力視されているモデルとして N. D. Kim らが提唱した "adatom-tetramer-interstitial (ATI) モデル [2]"と、坂本らが提唱した "adatom-buckling (AB) モデル [3]"がある。そこで、本研究では、非常に表面敏感な光電子・オージェ電子コイ ンシデンス分光法 (Photoelectron – Auger-electron coincidence spectroscopy : PEACS) を 用いて Si(110)-16×2 清浄表面の表面原子配列モデルを検討した。

【実験】 Si(110)-16×2の単一ドメインは、超高真空下で次のように作製した。(1)Si(110) ウエハーを[112]方向に(横×縦=2×30 mm)に切り出し、アセトン、硝酸、純水の順に洗 浄した。(2)Si(110)表面上の酸化物や汚染物質は、ウエハーを1400 K以上に加熱すること で取り除いた。(3)最後に、1523 Kでフラッシングした後、1200 Kで2秒間アニーリング、 60秒かけて927 Kまで温度を下げ30秒間のアニーリング、さらに827 Kで10分間のアニ ールを行うことで作製し、16×2構造は、低速電子線回折(LEED)で確認した。

光電子、オージェ電子スペクトル (PES、AES) および、Si $L_{23}VV$ オージェ電子をトリガ ーとして測定した Si 2p 光電子スペクトル (Si-2p-Si- $L_{23}VV$ PEACS) の測定は、Photon Factory のビームライン 12A に超高真空槽 (到達圧力: 2.3×10^{-8} Pa)を設置し、電子・電子 -イオンコインシデンス (EEICO) 分光装置 [4]を設置して行った。EEICO 分光装置は、同 軸対象鏡型電子エネルギー分析器 (ASMA) とダブルパス円筒鏡型電子エネルギー分析器 (DP-CMA) 等から構成されている。軟 X 線放射光 (SR) は、表面法線方向 84°より入射 し、エネルギー (hv) は 130 eV に設定した。測定前後における Si(110)-16×2 清浄表面の汚

染は、Si 2p 光電子スペクトルおよび LEED で確認 し、無視できる程度であった。

【結果と考察】 図1は、Si(110)-16×2 清浄表面 の Si *L*₂₃*VV* AES である。図中の破線(a)-(d)は、 Si-2*p* Si-*L*₂₃*VV* PEACS 測定のトリガーシグナルと した Si *L*₂₃*VV* オージェ電子の運動エネルギー (*AeKE*) 位置である。図2は、同試料の(a) Si 2*p* 光電子スペクトル (実線+■) と(b) トリガーシグ



図1.Si(111)-16×2 清浄表面の Si *L*23*VV* オージェ電子スペクトル。

ナルの AeKE が 89.5 eV のときに得られた Si-2*p*-Si-*L*₂₃*VV* PEACS (■) である。両スペク トルともに文献を参照し、Voigt 関数を用いて基 板(bulk)サイトと5つの表面サイト(SC1-5) に分離した [2,3]。トリガーの AeKEが 87.5、92.0 および、94.0 eV の結果についても同様のフィッ ティングを行った。それぞれのスペクトルについ て、全ピーク面積に対する Bulk および SC1-5 成 分の占有率を求めて、表1にまとめた。全ての Si-2p-Si-L23 VV PEACS の成分分離の結果を Si 2p PES のそれと比較すると、Bulk と SC3 サイ トの占有率がいずれも減少していることが分か る。これは、SC3 サイトが第1層以下の Si サイ トであることを示唆している。一方、SC1とSC5 サイトの占有率は高くなっている。特に、SC5 サ イトの占有率は、トリガーシグナルの AeKE が大 きくなるほど顕著に大きくなっていることが分 かる。これは、SC1 と SC5 サイトが表面第1層



図2. (a) Si(110)-16×2 清浄表面の Si 2p 光電子スペクトル。(b)同試料の Si-2p Si-L₂₃ VVPEACS (トリガーとしたオージェ 電子の運動エネルギー=89.5 eV)。

のサイトであり、特に、SC5 はフェルミ準位直下に電荷密度を強く持つ表面サイトであるこ とが示唆される。さらに、SC2 と SC4 の占有率を比較すると、一方が増加(減少)すれば他 方が減少(増加)する関係にあることが分かる。この結果を満たすのは、SC1 が表面第1層 の ad-atom、SC2 が unsatulated π band chain、SC3 が second layer、SC4 が satulated π band chain、SC5 表面第1層目でもっとフェルミ準位側に電荷密度分布を持っている tetramer と なっている ATI モデルである [2]。AB モデルでは、本実験結果を満足し難い。よって、 Si(110)-16×2 清浄表面の最安定構造モデルは、ATI モデルが最適であると考えられる。

表1. Si-2p-Si-L23 VV PEACS 及び Si 2p PES のカーブフィッティング結果による各ピーク
面積占有率。括弧内の矢印は、Si 2p PES の各ピークの面積占有率と Si-2p Si-L23 VV PEAC
のそれを比較した時の増減を示している。

Kinetic energy of Si						
$L_{23}VV$ Auger electron	Bulk (%)	SC1 (%)	SC2 (%)	SC3 (%)	SC4 (%)	SC5 (%)
taken as trigger signal						
87.5 eV	17(↓)	10(↑)	18 (-)	19(↓)	23 (↑)	13())
$89.5 \mathrm{~eV}$	11 (↓)	$10(\uparrow)$	$26\left(\uparrow ight)$	$22 (\downarrow)$	13())	$18(\uparrow)$
92.0 eV	$21 (\downarrow)$	8(↑)	$20\ (\uparrow)$	16 (\downarrow)	13(\)	$22~(\uparrow)$
94.0 eV	10 (↓)	8(↑)	16 (\downarrow)	$21 (\downarrow)$	19(↑)	$26\ (\uparrow)$
Si $2p$ PES (Singles)	31	5	18	25	15	6

【参考文献】 [1] Y. Yamada *et al.*, 表面科学 **29**, 401 (2008), [2] N. D. Kim *et al.*, Phys. Rev. B **75**, 125209 (2007)., [3] K. Sakamoto*et al.*, Phys. Rev. B **79**, 045304 (2007)., [4] T. Kakiuchi et al. J. Vac. Soc. Jpn. 51, 749 (2008).